

日本の特許庁による特許行政年次報告書2026年版の内容と反響分析

エグゼクティブサマリー

特許庁が2026年7月27日に公表した『特許行政年次報告書2026年版』は、2025年の日本の産業財産権行政を「確定値ベース」で総覧する資料であり、確認できる最大のニュースは、**特許出願件数が358,317件と前年比16.8%増**になったことです。一方で、意匠登録出願は31,853件で前年から微減、商標登録出願は168,114件で増加に転じました。グラフ・統計の設計を見ると、今回の報告書は日本国内の件数だけでなく、**五庁比較、PCT比率、主要特許庁の特許査定率、さらにはインドや南アフリカの出願構造**まで視野に入れており、従来よりも「日本の位置取り」を国際比較で読ませる構成が強いのが特徴です。 ¹

制度・政策面では、この年次報告書は単独の大型法改正案を打ち出すというより、**AIを使った審査運用の高度化と、今後の制度改正論点の可視化**を前面に出しています。具体的には、生成AIを使った検索インデックス自動生成・自動付与の試行「GAIA-Index」の開始、特許制度小委員会でのネットワーク関連発明等の権利保護の検討、デザイン制度小委員会での仮想空間デザイン・生成AI対応の継続検討、商標法改正に伴うコンセント制度対応システム整備などが並びます。同日に経済産業省・特許庁が「JPO AIビジョン」を公表していることから、**2026年版年次報告書は“AIを前提に再設計される知財行政”の年次記録**として読むのが適切です。 ²

反響は、公開翌日の2026年7月28日時点ではまだ初動段階ですが、確認できた範囲では、**メディア・実務家・SNSの関心は報告書全体よりも「AI活用」と「特許出願急増」の二点に集中**しています。日経系は「最終判断は人間」と人間関与を強調し、読売系は国際ルール形成の文脈で取り上げ、日刊工業新聞系は「審査品質を守りつつ迅速化」という実務寄りの整理を示しています。SNSでは、JPO公式の告知に加え、実務家が年次報告書掲載グラフを見て**インドの出願構造の変化**に反応する投稿が目立ち、別系統ではJPO AIビジョンを企業のAIガバナンス設計の参考例として読む投稿が現れています。 ³

短期的には、特許出願の急増に対して審査期間がどう耐えるかが最大の論点です。実際、**特許審査のFA期間は2024年度の9.1か月から2025年度は9.4か月、権利化までの期間も13.0か月から13.2か月へやや伸長**しており、意匠・商標が短縮したのとは対照的です。中長期では、AI支援審査、ネットワーク関連発明、仮想空間・生成AIと意匠制度、デジタル手続、国際ワークシェアリングが制度設計の主戦場になる可能性が高い一方、審査品質の担保、AIの説明責任、機密保護、立法化までの時間差がボトルネックになります。 ⁴

報告書要旨

報告書の構成と読み筋

特許庁の2026年版年次報告書は、**特許・意匠・商標・審判・多様なユーザー支援・人材育成・国際的取組・制度見直し**という全8章構成で、公表ページから本文PDFと、Excel/CSV形式の統計ダウンロードページが併設されています。つまり、今回の報告書は「政策の説明資料」であると同時に、「再利用可能な統計基盤」でもあります。 ⁵

この構成から読み取れるのは、2026年版が単に件数を並べる報告書ではなく、**統計・運用・将来制度論を一つの物語に接続する設計**になっていることです。第1部では主要統計を国際比較で見せ、第2部では各制度の

運用と支援策、第8章で今後の制度見直し論点を示しており、「現在地」「実務」「次の改正論点」が一続きに置かれています。 6

主要統計のポイント

2025年の確定値では、特許出願358,317件、意匠登録出願31,853件、商標登録出願168,114件です。前年2024年はそれぞれ306,855件、32,065件、158,792件だったため、**特許は16.8%増、意匠は約0.7%減、商標は約5.9%増**でした。特許だけが突出して大きく伸びた一方、意匠はほぼ横ばい圏、商標は減少トレンドからの反転という形です。 7

ただし、この特許増をそのまま「国際出願の増加」と読むのは正確ではありません。ステータスレポートを用いた実務家解説では、2025年の総特許出願358,317件のうち**PCT出願からの国内移行は72,011件**で、2024年の72,888件よりも877件少なく、**国内移行を除く特許出願は286,306件**でした。つまり、今回の増加分の主要部分はPCT経由ではなく、**国内系出願の増加**とみるのが自然です。 8

外国から日本への特許出願は2025年で70,735件で、内訳シェアは米国34.8%、欧州28.9%、中国15.3%、韓国13.7%でした。日本から海外への特許出願は2024年で184,474件で、行き先の比率は米国40%、中国25%、欧州11%、韓国7%です。したがって、日本の特許行政は依然として**米国との連結が最も太い**一方、中国比重も相当に大きく、対中・対米の両建て戦略が前提になっています。 9

意匠と商標は、総件数だけを見ると変化が小さく見えますが、内訳を見ると構造変化があります。意匠は2025年に**国際意匠登録出願が5,274件**まで増えた一方、国内系が26,579件に下がったため、全体では微減でした。商標は2025年に**国際商標登録出願16,570件、国内系151,544件**となり、両方の増加で合計168,114件へ回復しました。意匠は国際化が進む一方で国内母数が弱く、商標は国内需要と国際登録の双方が戻った、というのが2026年版の読み方です。 10

審査スピードと成立率

運用面で最も重要なのは、特許出願急増と審査スピードの関係です。2025年度の特許審査は、**審査請求から一次審査通知まで9.4か月、権利化まで13.2か月**でした。前年2024年度はそれぞれ9.1か月、13.0か月だったため、**特許だけはやや悪化**しています。これに対して、意匠はFA期間5.9か月・権利化6.6か月、商標はFA期間6.6か月・権利化7.5か月で、いずれも前年より短縮しました。 11

審査結果の質・厳しさを見る指標として、2025年の**特許査定率76.5%、意匠登録査定率88.0%、商標登録査定率87.5%**が示されています。前年は特許76.3%、意匠89.4%、商標88.4%でしたから、特許はほぼ横ばい、意匠・商標はやや低下です。件数増の中でも特許査定率が大きく崩れていない点は、審査運用が直ちに緩くなったことを示すものではありませんが、意匠・商標では登録率のわずかな低下が見られます。 12

また、即戦力的なユーザー施策として、2025年の**早期審査申請は22,272件、スーパー早期審査申請は1,714件**で、早期審査の一次審査通知までの期間は平均2.3か月でした。出願急増局面でも、重要案件は相当短い期間で処理する設計が維持されています。 13

制度見直しと注目技術分野

制度改正論点として最も重要なのは、特許制度小委員会とデザイン制度小委員会の議論です。特許制度小委員会では2025年度に4月・6月・11月の会合を開き、**DX時代にふさわしい産業財産権制度をめぐって、国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護**を検討しています。デザイン制度小委員会では、**仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方と、生成AI技術の発達を踏まえた意匠制度上の対応**を継続検討しています。ここは今後3～5年で法制度に結実する可能性が高い論点です。 14

他方で、既に進んでいる実装型の制度対応もあります。意匠分野では、**令和5年意匠法改正に沿った新規性喪失の例外手続の緩和**に対応する審査基準・審査便覧・Q&Aの整備が進み、商標分野では**2025年3月にコンセント制度導入に対応するシステム改修、2026年1月にオンライン発送制度見直しへのシステム改修**が完了しています。したがって、年次報告書のメッセージは「全面改正より、まず運用とデジタル基盤を先行させる」に近いと言えます。 15

AI活用では、報告書本文で**GAIA-Index**の試行開始が明記されています。これは生成AIを使って新たな検索インデックスを自動生成し、自動付与する取組で、4つのテーマで試行を始めたものです。しかも同日にMETI/JPOが「JPO AIビジョン」を発表し、**高品質・迅速な行政サービス、人間中心、リスクへの適切対応**を掲げました。年次報告書単体よりも、この同日公表のAIビジョンと合わせて読むことで、特許庁の2026年の政策軸がはっきり見えます。 16

注目技術分野としては、特許出願技術動向調査の2025年度テーマに**核融合発電、低炭素燃料エンジン、乳酸菌入り食品、サイバー攻撃検知技術**が挙げられています。半導体では、調査センターの新規事業として**半導体サプライチェーンに関する調査**も言及されています。報告書は単に“AI一色”ではなく、**エネルギー、サイバー、ライフサイエンス、半導体**という産業政策上の重要領域を横断的に押さえています。 17

国際協力では、WIPOやEPO、ブラジル、カナダ、チリ、中国などとの連携が言及され、さらに**途上国のPCT、ハーグ協定、マドリッドプロトコルへの加入・利用促進**やIT支援が挙げられています。これは、JPOが国内審査庁であるだけでなく、**国際制度の普及者・ワークシェアリングのハブ**としてふるまおうとしていることを意味します。PPHやPCT-PPHが「他庁の成果利用による迅速化」を狙う制度であることを踏まえると、この方向性は実務上かなり一貫しています。 18

反響の要約

公開翌日時点で確認できた反響は、**大手紙の深掘り社説や業界団体の正式声明**というより、**見出し報道、実務家解説、SNS上の即時反応**が中心です。つまり、2026年版に対する世の中の受け止めは、まだ「定着した評価」ではなく「初期フレーミング」の段階にあります。 19

反応主体	確認できた主な切り口	論調の整理
日経系	「特許審査にAI活用指針、業務迅速に最終判断は人間で」	中立～前向き 。AI活用を認めつつ、人間の最終判断を強調。 20
読売系	「特許審査にAI活用指針 国際ルール作り狙う」	中立 。国内効率化より、国際ルール形成の文脈で整理。 21
日刊工業新聞系	「知財行政 AI積極活用 特許庁、審査品質守り迅速に」／「特許出願16%増35万件 昨年、AI関連寄与か」	前向きだが慎重 。件数増とAI推進を歓迎しつつ、品質確保と要因分析を残す。 22

この論調分類から分かるのは、報道関心が「年次報告書の全体構成」ではなく、**AIビジョンとの接合点と特許出願急増の解釈**に集中していることです。特に「AI関連寄与か」という見出しは、現時点ではあくまで新聞側の仮説的 framing であり、年次報告書自身が急増要因をAIに特定しているわけではありません。そのため、ここは**報告書の事実と報道の推測**を分けて読む必要があります。 23

実務家・専門家の初動コメントは、比較的具体的です。小山特許事務所は公開翌日に特許・意匠・商標の統計解説を連続公開し、出願内訳、本人出願率、審査期間、審判件数までQ&A形式で整理しました。トランスユーロは「国内出願の反発増」と「ドイツからの出願減」に注目し、**特許登録件数は184,807件で2022年以**

降初めて20万件を下回ったと読んでいます。IPStartや三枝国際特許事務所は、2026年3月のステータスレポート段階から、**PCT国内移行ではなく国内系出願の増加**が伸びの中心だと分析していました。 ²⁴

業界別に見ると、**半導体**はサプライチェーン調査の明記と早期審査の実効性からプラス材料が多く、**AI・ソフトウェア**はAI審査支援、ネットワーク関連発明、JPO AIビジョンの三点が重なるため最も注目度が高い分野です。**バイオ・食品**はメディア露出こそ小さいものの、「乳酸菌入り食品」が調査テーマになっていることから、特許行政としては依然重視分野に入っています。**エネルギー**は核融合発電、**サイバー**は攻撃検知技術が明示されており、経済安全保障と結びつきやすい論点が前景化しています。 ²⁵

SNS上の論点は、少なくとも二つに分かれています。第一は、JPO公式・METI公式が報告書とAIビジョンを告知し、JPOのAI利用方針を広報した流れです。第二は、実務家コミュニティが年次報告書の図表自体を材料に議論している流れで、特に「**インドにおける特許出願構造**」の図に触発された「**第二の中国になるのではないか**」という議論が複数投稿で拡散しています。これは、SNSが件数そのものよりも**地政学的・将来市場的な含意**を拾っていることを示します。 ²⁶

さらに、XやLinkedInでは、JPO AIビジョンを日本企業側のAIガバナンスのモデルとして読む投稿も見られました。Xでは「人間中心の原則」「リスク対応」を要点化する投稿が現れ、LinkedInでは、JPOが掲げた**高品質・迅速なサービス、責任あるAI活用、エコシステム基盤強化**が企業内部のAI導入・運用論に転用可能だとする整理が投稿されています。つまり、SNS上では年次報告書そのものより、**その周縁にある“AI行政の設計思想”が実務テンプレートとして消費されている**と言えます。 ²⁷

詳細データ表

まず、件数面の全体像を整理すると次のとおりです。なお、増減率は2024年版・2026年版の公式件数から算出しています。 ⁷

指標	2024年	2025年	増減の読み方
特許出願件数	306,855	358,317	+16.8% 。3権利の中で突出した増加。
意匠登録出願件数	32,065	31,853	-0.7% 。国際意匠は増えたが国内系が減少。
商標登録出願件数	158,792	168,114	+5.9% 。減少傾向から反転。
PCT国内移行を含む特許総件数	306,855	358,317	増加の中心はPCT国内移行ではなく国内系。
PCT国内移行件数	72,888	72,011	わずかに減少。
日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願	—	46,305	2019年ピークからは漸減傾向。

出典の内訳を見ると、**特許増は“国際出願流入の増勢”ではなく“国内系出願の増勢”**と読むのが適切です。これは政策評価上かなり重要で、景気・投資・生成AI関連の出願行動の変化、あるいは企業側の知財投資の方向転換を示唆しますが、原因の断定までは報告書だけではできません。 ⁸

審査スピードと成立率の比較は次のとおりです。ここでは**特許だけがやや鈍化し、意匠・商標は改善した点**が最重要です。 ²⁸

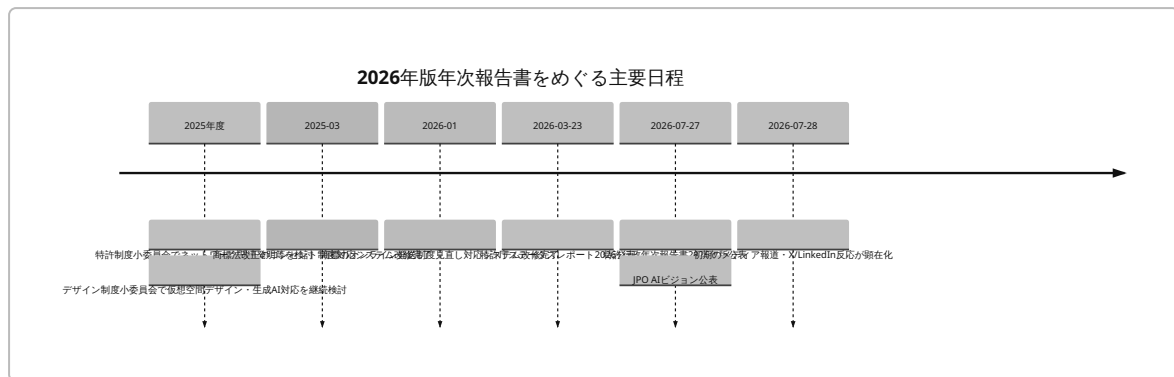
指標	2024年度・2024年	2025年度・2025年	含意
特許 FA期間	9.1か月	9.4か月	出願急増の影響が先に出ている可能性。
特許 権利化までの期間	13.0か月	13.2か月	わずかに伸長。
特許査定率	76.3%	76.5%	スピード悪化の一方、査定率はほぼ横ばい。
意匠 FA期間	6.2か月相当から短縮傾向	5.9か月	改善。
意匠 権利化までの期間	2024年度より長い	6.6か月	短縮。
意匠登録査定率	89.4%	88.0%	やや低下。
商標 FA期間	6.9か月	6.6か月	改善。
商標 権利化までの期間	2024年度より長い	7.5か月	短縮。
商標登録査定率	88.4%	87.5%	やや低下。

補助的に、ユーザーにとって重要な運用数値も押さえておくべきです。2025年の**早期審査申請22,272件、スーパー早期審査1,714件、早期審査のFA2.3か月**は、日本が依然として“重要案件は非常に速い”庁であることを示します。また、外国人の日本出願70,735件、日本から海外出願184,474件という数字は、報告書が国内行政資料でありながら、実務上は国際出願戦略の参照資料としても使えることを意味します。 ²⁹

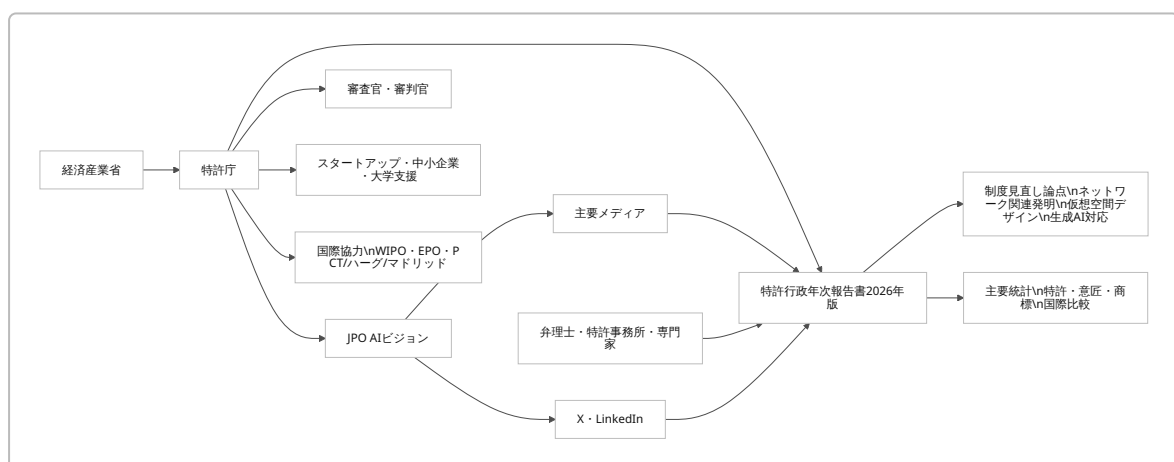
2026年版は、国際比較や新興国比較の図表も拡充しています。統計ダウンロードページには、**五庁の特許出願件数推移、一次審査通知までの期間、主要特許庁の特許査定率、PCT国際出願比率**に加え、**インドや南アフリカの特許出願構造**まで並んでいます。これは、日本の知財行政が自国の処理件数管理だけでなく、**グローバル競争地図の中でのJPOの位置**を見せる方向により**明確に舵を切っている**ことを示します。 ³⁰

なお、2026年3月の**ステータスレポートは速報版**であり、7月の年次報告書では一部数値が更新されています。たとえば、IPStartのステータスレポート解説では2025年意匠登録出願件数を31,781件としていましたが、7月の年次報告書確定値は31,853件です。実務上は、**海外説明や早期判断にはステータスレポート、国内の正式記録や比較分析には年次報告書**という使い分けが妥当です。 ³¹

以下のタイムラインは、本報告書と関連施策の流れを簡略化したものです。 ³²



関係者の関係を単純化すると次の図になります。年次報告書は単独文書ではなく、審査運用、制度改正、国際協力、スタートアップ支援、メディア・SNSの言説が交差するハブです。 33



影響評価と提言

短期的な影響として最も大きいのは、**特許出願急増と特許審査期間の軽微な悪化が併存**している点です。特許ではFA期間が9.1か月から9.4か月、権利化までが13.0か月から13.2か月に伸びており、出願件数の増加が続けば、2026～2027年にかけてボトルネック化する可能性があります。一方で、意匠・商標は審査期間が短縮しているため、行政資源の圧迫はまず**特許審査部門に集中**すると見るべきです。 11

その意味で、2026年版が打ち出すGAIA-IndexやJPO AIビジョンは、単なる先端アピールではなく、**出願増に対抗する実務上の必要条件**です。ただし、日経系報道が「最終判断は人間」と表現したように、AI導入が正当化されるのは、検索精度・説明可能性・情報管理・責任分界が確保される場合に限られます。特許庁自身もAIビジョンで人間中心・リスク対応を掲げており、政策実行の確率は高いものの、**フルオートメーションではなく“人間主導のAI補助”にとどまる**という読みが妥当です。 34

中長期では、3～5年スパンで三つの制度論点が特に大きいと考えられます。第一に、**ネットワーク関連発明や越境的事業活動に対応する特許制度**です。第二に、**仮想空間・生成AIと意匠制度**の接続です。第三に、**商標・発送・電子手続のさらなるデジタル化**です。これらはすでに小委員会やシステム改修として走っているため、実行可能性は高いですが、立法レベルの改正に進むには業界・法曹・学界の利害調整が必要で、**政策の方向性は明確でも制度確定には時間を要する**でしょう。これは報告書の叙述からかなり強く推測できます。 35

産業別には、**半導体**はサプライチェーン調査と早期審査の維持が直接追い風です。**AI・ソフトウェア**は最も政策恩恵が大きい一方、権利範囲設計と審査の整合性が難しく、制度改正待ちの領域も多いです。**バイオ・**

食品はメディア注目度は低いものの、調査テーマ入りしている以上、特許庁は依然として重点監視しています。核融合・低炭素エンジン・サイバーは、知財戦略と産業政策・安全保障政策が重なる領域として重みが増す可能性があります。 25

政策担当者への提言としては、まず特許審査の滞留兆候を月次で可視化し、AI導入効果を「件数処理」だけでなく「拒絶理由の安定性」「再検索率」「審判移行率」でも検証すべきです。企業には、2025年の件数増を“競合も動き出したシグナル”として受け止め、AI関連発明・標準関連・サプライチェーン関連で出願の量よりポートフォリオ再編を急ぐことを勧めます。研究者・大学には、PCT手数料減免やIPAS等の支援策を活用し、技術テーマが報告書の調査対象に入った段階で、研究成果の権利化と事業仮説を並行設計することが重要です。これらは、報告書が示した支援策と制度論点から直接導ける実務的含意です。 36

参考出典リスト

- ・特許庁「特許行政年次報告書2026年版」公表ページ・目次。 37
- ・特許庁「特許行政年次報告書2026年版をとりまとめました」要約ページ。 38
- ・特許庁「特許行政年次報告書2026年版統計情報ダウンロード」。 39
- ・経済産業省「特許庁におけるAI活用の基本方針『JPO AIビジョン』を策定しました」およびJPOの関連ページ。 40
- ・小山特許事務所による2026年版統計解説（特許・意匠・商標）。各数値は特許庁年次報告書に基づく再整理。 41
- ・トランスユーロ株式会社「最新知財動向 特許庁ステータスレポート2026から見える、気になる今後の動向」。 42
- ・IPStart国際特許事務所「特許庁ステータスレポート2026のご紹介」。 43
- ・弁理士法人三枝国際特許事務所「『日本』特許庁ステータスレポート2026が公表されました」。 44
- ・JPO公式Xによる年次報告書・JPO AIビジョン告知。 45
- ・実務家・専門家のX/LinkedIn反応例。インドの出願構造への反応、JPO AIビジョンの要点整理、企業AIガバナンスへの応用。 46
- ・国際協力の制度背景としてのJPO/WIPO/EPOのPPH・PCT-PPH説明。 47
- ・英語圏の補足的受け止めとして、JPO Status Report 2026に関するJones Day等の要約。 48

1 4 7 11 12 19 28 38 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/matome.html>

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/matome.html>

2 13 14 15 16 17 18 25 29 32 33 34 35 36 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/document/index/0200.pdf>

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/document/index/0200.pdf>

3 20 https://x.com/nikkei_keizai/status/2081704264548970625

https://x.com/nikkei_keizai/status/2081704264548970625

5 37 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/index.html>

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/index.html>

6 30 39 <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/graph.html>

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2026/graph.html>

8 43 <https://ipstart.jp/status-report-2026/>

<https://ipstart.jp/status-report-2026/>

9 24 41 https://www.koyamapat.jp/2026/07/28/report_patent_2026/

https://www.koyamapat.jp/2026/07/28/report_patent_2026/

- 10 https://www.koyamapat.jp/2026/07/28/report_design_2026/
https://www.koyamapat.jp/2026/07/28/report_design_2026/
- 21 <https://x.com/patesalo/status/2081482762976977241>
<https://x.com/patesalo/status/2081482762976977241>
- 22 <https://x.com/patesalo/status/2081491541957242955>
<https://x.com/patesalo/status/2081491541957242955>
- 23 <https://x.com/patesalo/status/2081489157684138388>
<https://x.com/patesalo/status/2081489157684138388>
- 26 45 https://x.com/jpo_NIPPON/status/2081564803026608477
https://x.com/jpo_NIPPON/status/2081564803026608477
- 27 https://x.com/m_masuda/status/2081662103426093304
https://x.com/m_masuda/status/2081662103426093304
- 31 <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2026/index.html>
<https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/2026/index.html>
- 40 <https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260727001.html>
<https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260727001.html>
- 42 <https://www.trans-euro.jp/blog/%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E5%8B%95%E5%90%91%E3%80%80%E7%89%B9%E8%A8%B1%E>
<https://www.trans-euro.jp/blog/%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%9F%A5%E8%B2%A1%E5%8B%95%E5%90%91%E3%80%80%E7%89%B9%E8%A8%B1%E>
- 44 <https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/18813/>
<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/18813/>
- 46 https://x.com/e_patent/status/2081716241753108684
https://x.com/e_patent/status/2081716241753108684
- 47 <https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html>
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html>
- 48 <https://www.jonesday.com/en/insights/2026/05/japan-patent-office-publishes-its-yearly-status-report-for-2026>
<https://www.jonesday.com/en/insights/2026/05/japan-patent-office-publishes-its-yearly-status-report-for-2026>